(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-94179

(P2000-94179A)

(43)公開日 平成12年4月4日(2000.4.4)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ					テーマコート*(参考)
B 2 3 K	35/22	310		B 2	3 K	35/22		310A	5 E 3 1 9
	1/20					1/20		J	5 E 3 4 3
	35/363					35/363		E	
	35/40	3 4 0				35/40		3 4 0 Z	
H05K	3/24			H0	5 K	3/24		F	
			審查請求	未請求	於簡	マダス 3	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平10-267534		(71)	出頭	Å 000233	3860		
						・ハリマ	化成株	式会社	
(22)出願日		平成10年9月22日(1998.9	. 22)			兵庫県	加古川	市野口町水足	671番地の4
				(72)	発明	計 入江	久夫		
						兵庫県	加古川	市野口町水足	1671番地の4
						ハリマ	化成株	式会社中央研	究所内
				(72)	発明	皆 高橋	政典		
						兵庫県	加古川	市野口町水足	671番地の4
						ソカム	化成株	式会社中央研	究所内
				(74)	代理	ላ 10008 2	2027		
						弁理士	竹安	英雄	
									MI Alexandra and A

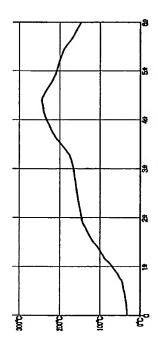
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ソルダベースト及びその製造方法並びにはんだプリコート方法

(57)【要約】

【課題】 リフローにより加熱してはんだ粒子が熔融したときに、当該はんだ粒子同士が合体して大きな熔融はんだ粒子が生じることが少なく、小ピッチのパッドに対してもはんだ量のばらつきが少く、且つブリッジが生じることのないソルダペーストを提供することを目的とする。

【解決手段】 はんだ粉末とフラックスとの混合物よりなるソルダベーストにおいて、前記はんだ粉末の平均粒径が $4\sim20\mu$ であって、当該はんだ粉末の表面に均一な酸化皮膜が形成されており、そのはんだ粉末の酸素含有量が $700\sim3000$ ppmである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 はんだ粉末とフラックスとの混合物よりなるソルダベーストにおいて、前記はんだ粉末の平均粒径が4~20μであって、当該はんだ粉末の表面に均一な酸化皮膜が形成されており、そのはんだ粉末の酸素含有量が700~3000pmであることを特徴とする、ソルダベースト

【請求項2】 平均粒径4~20μのはんだ粉末を、空気中で流動せしめることによりその表面に酸化皮膜を形成し、当該酸化皮膜を形成したはんだ粉末をフラックス 10と混合することを特徴とする、ソルダベーストの製造方法

【請求項3】 請求項1に記載のソルダペーストを、ブリント基板上にベタ塗りし、これを加熱することによりプリント基板のパッド上に選択的にはんだを付着させることを特徴とする、はんだプリコート方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はソルダベーストに関するものであって、特に電子部品をブリント基板に実装 20 するに際し、当該ブリント基板にはんだをブリコートするのに適したソルダベーストに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、電子部品をブリント基板に実装する場合、スクリーン印刷法などの手段により、ブリント基板のパッド上にソルダベーストを印刷し、その上に電子部品のリードを載置し、これをリフロー炉に通して加熱し、ソルダベーストを熔融させてリードとパッドとをハンダ付けすることが行われていた。

【0003】また、近年電子機器の小型軽量化に伴って、電子部品が小形化すると同時にリードの数が増加し、これに対応してブリント基板におけるバッドのビッチが小さくなり、小ビッチで配列された個々のバッドに正確にソルダベーストをスクリーン印刷することが困難となってきた。

【0004】そこでとのようなバッドが小ピッチに配列された部分については、ソルダベーストをかかる部分全体に亙ってベタ塗りし、これを加熱してハンダ粒子を熔融せしめてバッド上にはんだをプリコートしておき、この上にフラックスを塗布して電子部品のリードを載置し、リフロー炉に通して加熱してブリコートされたはんだを熔融し、当該はんだによってバッドとリードとをはんだ付けする方法が取られるようになっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】との方法においては、 熔融したはんだ粒子がパッドの金属に接触して、その金 属の表面を溜らして拡がることにより、はんだが選択的 にパッド表面に付着してブリコートされるのである。

【0006】しかしながらはんだ粉末の粒子が熔融する 錫-鉛系共晶合金が使用されるが、必要に応じて錫-銀 ととにより、当該熔融はんだ粒子同士が合体して粒子径 50 系や錫-亜鉛系などの公知のはんだ合金を使用するとと

が大きくなり、これがバッドの金属に付着することとなるため、バッドのビッチが極端に小さくてバッドの大きさが小さい場合には、バッドに付着させるべきはんだの量に比べて、合体して拡大したはんだ粒子の一個が含むはんだの量の比率が大きくなり、バッドごとに付着するはんだの量にばらつきが生じる。

【0007】また大きくなったはんだ粒子の径がパッドの間隔に匹敵するようになると、一個の大きな熔融はんだ粒子が複数のパッドに跨がって付着し、ブリッジが生じる確率が高くなり、良好なブリコートが得られないのである。

【0008】本発明はかかる事情に鑑みなされたものであって、加熱してはんだ粒子が熔融したときに、当該はんだ粒子同士が合体して大きな熔融はんだ粒子が生じることが少なく、小ピッチのパッドに対してもはんだ量のばらつきが少く、且つブリッジが生じることのないソルダベースト及び、当該ソルダベーストを使用したブリコート方法を提供することを目的とするものである。 【0009】

【課題を解決するための手段】而して本発明のソルダベーストは、はんだ粉末とフラックスとの混合物よりなるソルダベーストにおいて、前記はんだ粉末の平均粒径が4~20μであって、当該はんだ粉末の表面に均一な酸化皮膜が形成されており、そのはんだ粉末の酸素含有量が700~3000ppmであることを特徴とするものである

[0010]また本発明における、ソルダベーストの製造方法の発明は、平均粒径4~20μのはんだ粉末を、空気中で流動せしめることによりその表面に酸化皮膜を30形成し、当該酸化皮膜を形成したはんだ粉末をフラックスと混合することを特徴とするものである。

【0011】また本発明のはんだブリコート方法は、前述のソルダベーストを、ブリント基板上にベタ塗りし、 これを加熱するととによりブリント基板のバッド上に選択的にはんだを付着させることを特徴とするものである。

【0012】本発明のソルダベーストは、はんだ粉末とフラックスとよりなるものである。本発明においては、はんだ粉末の平均粒子径は、4~20 µであることが必40 要である。

【0013】平均粒子径が20μを超えると表面積が小さくなるため、はんだが熔融したときに熔融はんだ粒子の合体が生じやすく、また平均粒子径が4μ未満では表面積が過度に大きくなるため、はんだ粒子の凝集が生じやすく、いずれもパッド間のブリッジが生じやすくなる。

【0014】本発明のソルダベーストにおけるはんだ粒子の合金組成は、特に限定されるものではない。通常は 錫ー鉛系共晶合金が使用されるが、必要に応じて錫ー銀 系や錫ー亜鉛系などの分割のはんだ合金を使用するとと

だ粒子の径がハッド 個の大きな熔融はん 着し、ブリッジが生

:

Statement .

もできる。またこれらの共晶合金のみならず、ピスマス やインジウムなどの他の金属を添加したものを使用する こともできる。

【0015】また本発明のソルダペーストを構成するフ ラックスは、これも公知のフラックスを任意に使用する ことができ、例えばロジン系、ワックス系などのフラッ クス組成物を使用することができる。

【0016】而して本発明のソルダベーストは、はんだ 粉末がその表面に酸化皮膜が形成されており、そのはん だ粉末の酸素含有量が、700~3000ppmであると とに特徴を有している。

【0017】一般にはんだ付けにおいては、はんだ合金 の表面は清浄であることが要求され、空気中で必然的に 形成される酸化皮膜も、可及的に少ないことが必要であ るとされている。特にソルダペーストに使用されるはん だ粉末は、粒子径が小さく表面積が大きいために、空気 中で容易に酸化されるので、その製造に当たっては酸化 が生じないように厳しく管理され、一般には酸素含有量 が500ppm未満となるように管理されている。

【0018】 これに対し本発明においては、ブリント基 20 板のパッドへのプリコート用のソルダペーストとして、 前述のような従来の常識に反して、はんだ粒子に積極的 に酸化皮膜を形成することにより、熔融時のはんだ粒子 の合体を抑制し、ブリッジの発生を防止し得ることを見 出したのである。

【0019】本発明におけるはんだ粉末の酸素含有量 は、700~3000ppmとするべきである。酸素含有 量が700 ppm未満では、熔融時のはんだ粒子の合体を 防止する作用が不十分であり、ブリッジを防止すること ができない。また3000ppmを超えると酸化し過ぎで あって、パッドに対する濡れ性が低下してはんだ付け性 に劣り、良好なプリコートを得ることができない。

【0020】本発明におけるはんだ粉末は、はんだ合金 を窒素アトマイズ法により粉末化し、500メッシュ金 網のパス分として得ることができる。そしてこの方法で 製造されたはんだ粉末の酸素含有量は、良好に管理され た工程により500pm未満のものとして得ることがで

【0021】而してこのはんだ粉末を、空気中で流動せ 的には、円筒状の容器に容量の1~10容量%程度の量 のはんだ粉末を収容し、常温常圧の下でとの容器を水平 の回転軸で低速で回転させることにより、容器内ではん だ粉末を流動させ、空気と接触させて均一な酸化皮膜を 形成することができる。

【0022】はんだ粉末を流動させることなく静置した 状態で酸化させた場合には、酸化皮膜が不均一であっ て、熔融時のはんだ粒子の合体が生じ、酸素含有量が同 程度であっても十分な効果が得られない。

合することにより、本発明のソルダペーストが得られ る。フラックスは前述のように従来ソルダペーストに使 用されているものをそのまま使用することができ、また 混合の方法も従来のソルダペーストの製造と同様に行う ことができる。

【0024】本発明のブリコート方法においては、前記 酸化したはんだ粉末を使用した本発明のソルダペースト を、プリント基板上にベタ塗りする。具体的には、スク リーン印刷によるソルダペーストの印刷供給において、 10 スクリーンマスクとして、プリント基板上の個々のパッ ドでとに開口するのでなく、複数のパッドを含む広い節 囲に開口したものを使用する。

【0025】例えばクワッドフラットパッケージ(QF P) において、複数のパッドを小ピッチで並列させたQ FPの各辺ごとの形状に、又はそれらの辺を含むQFP 全体の形状に開口させたスクリーンマスクを使用し、小 ピッチで配列された多数のバッドを含む大きい範囲に、 個々のバッドの位置や形状を無視してラフにソルダベー ストを印刷するのである。

【0026】そして、このようにして本発明のソルダベ ーストをべた塗りしたプリント基板を、リフロー炉を通 過させて加熱し、ソルダペーストをリフローさせる。と のとき本発明によれば、プリント基板におけるパッドの 部分にのみ選択的に熔融はんだが付着してブリコートす るのである。

[0027]

【作用】本発明においては、はんだ粉末が酸化されてい るので、加熱してリフローしたときに、個々のはんだ粒 子が熔融してもその表面の酸化皮膜が残留しており、そ 30 のために熔融はんだ粒子が合体することがなく、微小粒 子のままでフラックス中を浮遊する。

【0028】この状態ではんだ粒子が沈降してバッドに 付着すると、はんだの濡れ性によってパッド表面に拡が り、パッドの表面にはんだによるプリコートが形成され るのである。またバッドのない絶縁基板の上において は、はんだ粒子は互いに合体することなく、微小粒子の はんだボールが形成されるが、これは後の洗浄工程にお いてフラックス残渣と共に容易に除去される。

【0029】表面に酸化皮膜が形成されたはんだ粒子 しめることによりその表面に酸化皮膜を形成する。具体 40 が、パッドの表面においてのみパッドに対する濡れ性を 発揮して付着する理由については必ずしも明確ではない が、パッドの表面がフラックスにより浄化されているた めに、清浄な銅の表面によってはんだ粒子の酸化皮膜が 破られ、熔融はんだがパッドに付着するのではないかと 考えられている。

【0030】そして熔融はんだ粒子同士の接触において は、はんだ粒子の表面が酸化皮膜で覆われているため に、当該酸化皮膜同士が接触しても互いに疎外し合い、 熔融はんだ同士の接触が生じないためにはんだ粒子の合 【0023】そしてとのはんだ粉末とフラックスとを混 50 体や成長が起こりにくく、微小粒子のはんだボールのま

まで残留するものと考えられる。

【0031】またパッドを形成する金属銅から生じる銅 イオンによる触媒作用、又は、パッドを構成する銅と、 はんだを構成する錫及び鉛とのイオン化傾向の違いが、 はんだ粒子のパッドへの付着に影響していることも考え られるが、理論的な解明は今後の研究に待たざるを得な・ 17

[0032]

【実施例】以下本発明を実施例に基づいて説明する。

【0033】 [はんだ粉末の準備] 試験に供するはんだ 10 粉末として、錫-鉛共晶はんだ及び、錫-銀共晶はんだ の粉末を用意した。各実施例及び比較例におけるはんだ 合金の組成、平均粒子径及び、初期の酸素含有量を表し に示す。

【0034】[はんだ粉末の酸化]はんだ粉末を次の二 法によって酸化した。本発明の実施例はすべて流動法で あるが、比較例において、流動法によるものと静置法に よるものとについて比較試験を行った。

【0035】流動法:容量5リットルの広口ポリエチレ ン容器にはんだ粉末2kgを収容し、容器の開口部を通気 20 【0039】 性を有するティッシュペーパーで閉塞し、この容器を輪*

*転機に載置し、25℃、湿度60%の恒温恒湿室におい て、60 rpmの回転速度で所定時間回転させた。

【0036】静置法:250mm×300mm×50mm(深 さ)のアルミニウム製バットにはんだ粉末2 kgを収容 し、これを80℃、湿度60%の恒温器中に所定時間に 亙って設置した。

【0037】各実施例及び比較例における酸化方法、酸 化に要した時間及び、得られた酸化はんだ粉末の酸素含 有量を表しに示す。

【0038】[ソルダベーストの調製]下記の組成によ りフラックスを調製し、これを表1に示す混合比率によ りはんだ粉末と混合して、ソルダベーストを調製した。 フラックス組成

WW級トールロジン	3 5 wt%
不均斉化トールロジン	1 2 wt%
セバシン酸	3 wt%
水素添加ポリテルペン	15 wt%
Nメチルジエタノールアミン	3 wt%
ジ エチレング リコールモノブ チルエーテル	3 2 wt%
[0000]	

【表1】

	はんだ	平均	初期酸素	酸化	酸化時間	最終酸素	はんだ粉/
例	組成	粒子径	含有量	方法		含有量	フラックス
		(μ)	(ppm)	7,14	(Hr)	(ppm)	(重量比)
実施例1	錫一鉛	1 2	400	流動法	200	1300	70/30
実施例2	錫一鉛	1 2	400	流動法	800	2000	60/40
実施例3	錫一鉛	6	480	流動法	4 8	1600	70/30
実施例 4	錫-銀	2 0	320	流動法	1000	1200	60/40
実施例 5	錫一銀	1 3	3 2 0	流動法	400	1400	70/30
実施例6	錫-銀	5	380	流動法	110	1800	60/40
実施例7	錫-銀	5	380	流動法	200	2200	50/50
実施例8	錫一鉛	6	480	流動法	600	2500	60/40
実施例9	錫一鉛	6	480	流動法	2 4	800	80/20
比較例1	錫一銀	1 3	320	なし	_	320	80/20
比較例2	錫一銀	1 3	320	静置法	2000	1300	70/30
比較例3	錫-銀	5	380	流動法	2000	4200	60/40
比較例4	錫-銀	2 5	120	流動法	1000	1200	70/30
比較例5	錫一鉛	6	480	静置法	1000	2000	60/40
比較例6	銀ー路	1 2	400	流動法	10	660	70/30
比較例7	錫-鉛	1 2	400	静固法	1000	1200	70/30
比較例8	錫一鉛	3 0	110	流動法	3000	2500	70/30

【0040】[プリント配線基板の準備] 導体のピッチ が0.25mm、0.3mm及び0.5mmで、導体の幅と間 隔の幅とが1:1のパッドを混載したファインピッチ追 従性デモ基板 (パッド材質:18μ厚銅箔)を用意し、 当該基板を硫酸と過酸化水素水の混合溶液中に20秒間 浸漬してパッド表面を清浄化し、さらにこれを水で洗浄 した後水切りし、乾燥させて試験に供した。

 $[0041][はんだプリコート]厚さ200<math>\mu$ で、3 Omm角に開口した、前記デモ基板に対応するスクリーン 較例のソルダベーストをべた塗り状に供給した。窒素ガ スを通して不活性雰囲気としたリフロー炉を、図1に示 す温度プロファイルに設定し、ソルダペーストを供給し たデモ基板を通してソルダペーストをリフローした。然 る後、デモ基板をグリコール系洗浄剤に浸漬し、超音波 を照射してフラックス及びはんだボールを洗い落とし

【0042】以上の工程を、デモ基板のピッチバターン により必要に応じて2~4回繰り返し、デモ基板のパッ マスクを使用して、デモ基板に対して前記実施例及び比 50 ド上にはんだブリコートを形成した。このデモ基板に形

成されたはんだブリコートを20倍拡大鏡で観察して、 ブリッジの発生及び下地の露出の有無を調べた。その結 * [0043]

【表2】

果を表2に示す。

0.25mmピッチ 酸素 0.3mmピッチ 0.5mmピッチ 酸化方法 含有量 170-970-970-追従性 追從性 追従性 回数 (ppm) 回數 回数 実施例1 流動法 1300 2 良好 2 良好 3 良好 実施例2 流動法 2000 2 良好 2 良好 3 良好 実施例3 流動法 1600 2 2 良好 良好 3 良好 1200 2 2 実施例4 流動法 良好 良好 3 良好 流動法 1400 2 良好 $\overline{2}$ 実施例 5 良好 3 良好 1800 2 実施例 6 流動法 良好 2 良好 3 良好 実施例7 流動法 2200 3 良好 3 良好 4 良好 実施例8 流動法 2500 3 良好 3 良好 良好 4 実施例9 流動法 800 2 7' 179' 2 2 7 179 良好 比較例1 なし 320 1 7 179 1 7 199 1 プ チッジ 1300 比較例2 静置法 1 7 199 1 7 199 1 7 199 比較例3 流動法 4200 4 下地露出 下地露出 4 4 下地露出 流動法 1200 比較例4 1 7 177 7 179 1 7 199 1 2000 比較例 5 静置法 1 7 1,99 7 179 1 7. 999. 1 流動法 7, 823, 比較例 6 660 7' 979' 1 1 1 プリッジ 比較例7 静置法 1200 7 979 1 1 ブリッジ 1 7 179 比較例8 流動法 2500 1 プリッグ 1 7 979 1 7' 199'

[0044]

【発明の効果】以上の実施例の結果からも理解できるよ うに、本発明によれば、従来の常識に反してはんだ粉末 が高度に酸化されているにも拘らず、O. 25mmのファ インピッチにおいても、ブリッジも下地の露出もなく、 極めて良好にはんだのプリコートが形成される。

【0045】なお実施例9は酸素含有量がや、少ないの 30 で、ピッチが小さい場合には必ずしも良好な結果が得ら れていないが、ビッチがや、大きいものにあっては十分 に良好な結果が得られている。

【0046】とれに対し比較例1においてははんだ粉末 が酸化されていないために、また比較例6のものは酸化 はされているもののその程度が不十分であるために、フ ァインピッチの基板にべた塗りした場合にはブリッジが 発生し、良好なプリコートを形成することができない。 【0047】また比較例2、5及び7においては、はん だ粉末は実施例と同様に酸化されてはいるが、静置した 40 成することができるのである。 状態で酸化されているために酸化皮膜が不均一であっ て、はんだ粒子の合体が生じて巨大化し、それが隣接す るパッドに付着してブリッジを生じていると考えられ

【0048】また比較例3のものにおいては、酸化の程 度が過剰であるために、バッドの金属表面に対するはん だの塗れ性が低下し、プリコート形成工程を4回繰り返 しても、パッド表面に十分なプリコートを形成すること ができず、パッドの下地が露出している。

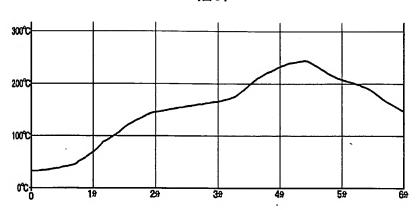
【0049】さらに比較例4及び8のものでははんだ粉 末の粒子径が大きいために、はんだ粒子の合体が生じや すく、隣接するパッド間に跨がってはんだがコートさ れ、ブリッジが発生している。

【0050】とのように本発明は、はんだ粉末の粒子径 が4~20 µで、酸素含有量が700~3000 ppmで あり、且つはんだ粒子の表面に均一な酸化皮膜が形成さ れているものであることが必要であり、かかる条件を満 たしたソルダベーストは、従来不可能であったファイン ビッチのプリント基板に対して、良好なプリコートを形

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例における、ソルダペーストをリフロー する際のプロファイルを示すグラフ

【図1】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

H 0 5 K 3/34

505

512

FΙ

H 0 5 K 3/34

テーマコード(参考) 505C

512C

(72)発明者 隈元 聖史

兵庫県加古川市野口町水足671番地の4

ハリマ化成株式会社中央研究所内

(72)発明者 櫻井 均

兵庫県加古川市野口町水足671番地の4

ハリマ化成株式会社中央研究所内

Fターム(参考) 5E319 BB05 CC33 CD25 CG05

5E343 B872 DD04 ER33 GG18